

編者的話

隨著數位科技的發展與應用多元，圖像設計已從應用於產品實體上，廣泛擴展至投影式介面、全像圖影像、虛擬實境及擴增實境等空間型數位設計，因而設計專利制度面臨衝擊與挑戰，促使許多國家修正專利法規及審查基準，以擴大圖像設計的保護客體及適用範圍。本期特別以「五大工業設計局之圖像設計保護制度介紹」為專題，提出（上）（下）2篇文章，彙整介紹美國、中國大陸、日本、南韓及歐盟等五大工業設計局成員之近期制度發展，期能協助各界掌握圖像設計保護之國際脈動與實務方向。此外，本期另有「文化創意永續與技術發展並進：我國著作權法資料探勘例外之增修可行性」之論述。以下就本期專題及論述簡介如下：

專題一由莊彩雪、耿筠所著「五大工業設計局之圖像設計保護制度介紹（上）——美國及中國大陸」，以美國專利商標局及中國大陸國家知識產權局為研究對象，分析其圖像設計之保護制度、揭露要件及近期案例發展，並針對新型態數位圖像在適格性與保護範圍上的差異，進行比較與探討。

專題二由莊彩雪、耿筠所著「五大工業設計局之圖像設計保護制度介紹（下）——日本、南韓及歐盟」，本文承繼上篇內容，續就日本特許廳、南韓智慧財產處及歐盟智慧財產局之圖像設計保護制度加以說明，並討論三者專利適格性以及物品性近似判斷上的異同。

論述由李姿儀、李諺樺所著「文化創意永續與技術發展並進：我國著作權法資料探勘例外之增修可行性」，析論生成式人工智慧技術進步對著作權法制所帶來的影響，並藉由介紹國際立法經驗，提供我國在政策發展的參考，期能建構兼顧創作生態與技術創新雙贏的環境。